

МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ГАЗОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ СЛОЕВ ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ

ИЗОТРОН ТМ 1

Назначение: Газофазное осаждение слоев нитрида и оксида кремния при пониженном давлении.



Особенности:

- Групповая обработка до 50 пластин до \varnothing 100 мм;
- Кварцевый реактор с термостатируемой рабочей зоной;
- Диапазон рабочих температур 300-900°C;
- Микропроцессорная система управления;
- Рабочие газы: N_2 , O_2 , NH_3 , SiH_4 , Ar;
- Безмасляная система откачки;
- Мощность потребления не более 12 кВт;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

